

脉宽压缩光栅用多层膜制备和性能测试

孔伟金, 沈健, 沈自才, 邵建达, 范正修

1 中国科学院上海光学精密机械研究所光学薄膜技术与研究发展中心, 上海 201800;2 中国科学院研究生院, 北京 100039

收稿日期 2004-11-1 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 给出了以413 nm作为写入波长, 1053 nm作为使用波长的多层介质光栅膜的设计, 计算表明膜系H3L(H2L)⁹H0.5L2.03H满足光栅膜的要求. 最后给出了制备得到的样品光学特性测试, 结果表明在使用波长和曝光波长处满足设计要求, 其抗激光损伤阈值在光正入射和51.2°入射时分别为14.14 J/cm²和9.32 J/cm², 膜系的应力表现为压应力.

关键词 [多层电介质光栅](#) [膜系设计](#) [性能分析](#)

分类号

通讯作者 kwjsd@163.com

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1468KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ 本刊中 包含“[多层电介质光栅](#)”的 [相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [孔伟金](#)
- [沈健](#)
- [沈自才](#)
- [邵建达](#)
- [范正修](#)